# Einführung in die Plasmaphysik

# Hochfrequenz-geheizte Niedertemperaturplasmen

Wolfgang Suttrop

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
D-85740 Garching

# Hochfrequenz-geheizte Niedertemperatur-Plasmen

### Wichtige Typen von HF-Plasmen:

- Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP)
- Kapazitiv gekoppeltes Plasma (CCP)
- Elektronen-Zyklotronresonanz-Plasma (ECR)



Beispiel: Leybold-Heraeus Z400

## Heizung durch Stöße (Gleichstrom-Entladung)

Arbeit an einem Elektron

$$dW_e = \vec{F} \cdot d\vec{x} = -eEdx$$

Leistung auf ein Elektron:

$$P_e = \frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t} = -eE\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -eEv_d = \frac{e^2E^2}{v_cm_e}$$
 (b) Plasmafrequenz:

Leistung pro Volumen (Leistungsdichte):

$$P = n_e P_e = \frac{n_e e^2 E^2}{v_c m_e}$$

 $v_c$ : effektive 90° Stoßfrequenz

Zusammen mit:

(a) Energiedichte des elektrostatischen Feldes:

$$U = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

$$\omega_{pe}^2 = \frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}$$

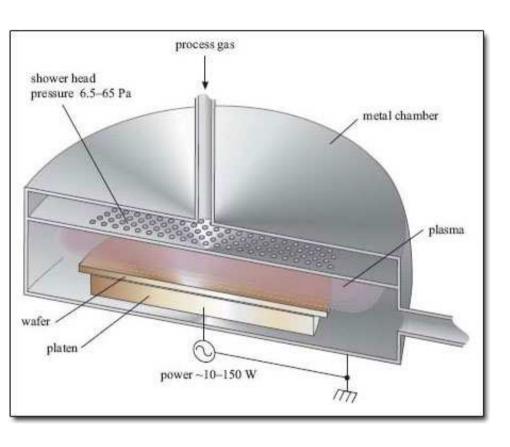
→ Leistungsdichte

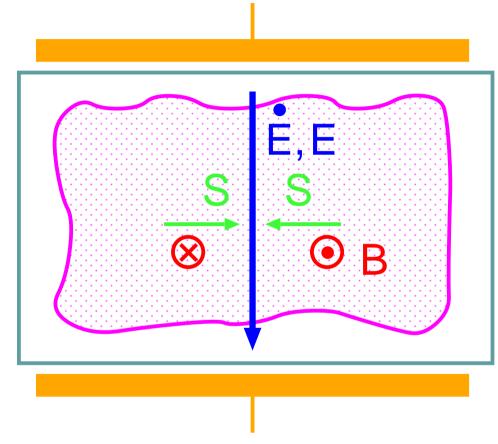
$$P = \underbrace{\frac{2\omega_{pe}^2}{v_c}}_{=v_*} U = 2\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} U = v_* U$$

 $v_*$ : "Energietransfer-Frequenz"

 $\sigma_0 = n_e e^2/(m_e v_c)$ : elektrische Leitfähigkeit

### Kapazitiv gekoppeltes HF-Plasma





Quelle: http://openlearn.open.ac.uk

Ampère + Ohm:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \varepsilon_0 \dot{\vec{E}}) = \mu_0(\sigma \vec{E} + \varepsilon_0 \dot{\vec{E}})$$

## Teilchenbewegung im elektrischen Wechselfeld, mit Dämpfung

Sei:  $\vec{E} = (E_o, 0, 0) \sin \omega t$ 

(ewige, unendlich ausgedehnte ebene Welle)

$$m\ddot{x} + mv_{c}\dot{x} = eE_{0}\sin\omega t$$

$$m\dot{v}_{y} + mv_{c}v_{y} = 0$$

$$m\dot{v}_{z} + mv_{c}v_{z} = 0$$

Lösung in *y*, *z*-Richtung:

$$v(t) = v_0 \exp(-\mathbf{v}_c t)$$

Lösung in *x*-Richtung:

Oszillation mit Phasenverschiebung vs. E(t)

$$x = C_1 \sin \omega \, t + C_2 \cos \omega \, t$$

in Bwgl. einsetzen  $\Rightarrow$  Konstanten

$$C_1 = -\frac{eE_0}{m} \frac{1}{(\omega^2 + v_c^2)}, \quad C_2 = -\frac{eE_0}{m} \frac{v_c}{\omega(\omega^2 + v_c^2)}$$

Ableiten → Geschwindigkeit:

$$v_x = \frac{eE_0}{m} \frac{1}{(\omega^2 + v_c^2)} \left[ \frac{v_c}{\omega} \sin \omega t - \cos \omega t \right]$$

Bei endlicher Dämpfung ( $v_c > 0$ ) bekommt die Geschwindigkeit einen Anteil in Phase mit dem anliegenden Wechselfeld, das Feld kann Leistung auf das Teilchen übertragen.

### Heizung durch Stöße im Wechselfeld

Leistung auf ein Elektron:

$$P_{e} = \frac{dW_{e}}{dt} = \frac{dW_{e}}{dx} \frac{dx}{dt} =$$

$$= eE_{0}\omega \left[ \underbrace{C_{1} \sin \omega t \cos \omega t}_{\text{Zeitmittel}=0} + C_{2} \sin^{2} \omega t \right]$$

zeitgemittelte Leistung auf ein Elektron:

$$P_e = \frac{e^2 E_0^2}{2m} \frac{v_c}{(\omega^2 + v_c^2)}$$

mittlere Energiedichte des el. Wechselfeldes:

$$< W_E > = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \sin^2 \omega t \, d(\omega t) = \frac{1}{4} \varepsilon_0 E_0^2$$

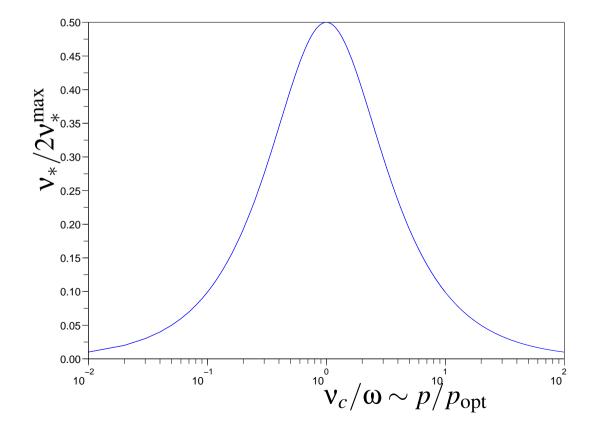
Leistungsdichte, übertragen auf Elektronen:

$$\langle P_E \rangle = \underbrace{\frac{2\omega_{pe}^2 v_c}{(\omega^2 + v_c^2)}}_{\equiv v_*} \langle W_E \rangle = v_* \langle W_E \rangle$$

# Stoßfrequenzabhängigkeit des Energietransfers

Der Energieübertrag ist maximal für  $\omega = v_c!$ 

$$\mathbf{v}_* = \frac{2\omega_{pe}^2 \mathbf{v}_c}{(\omega^2 + \mathbf{v}_c^2)}$$



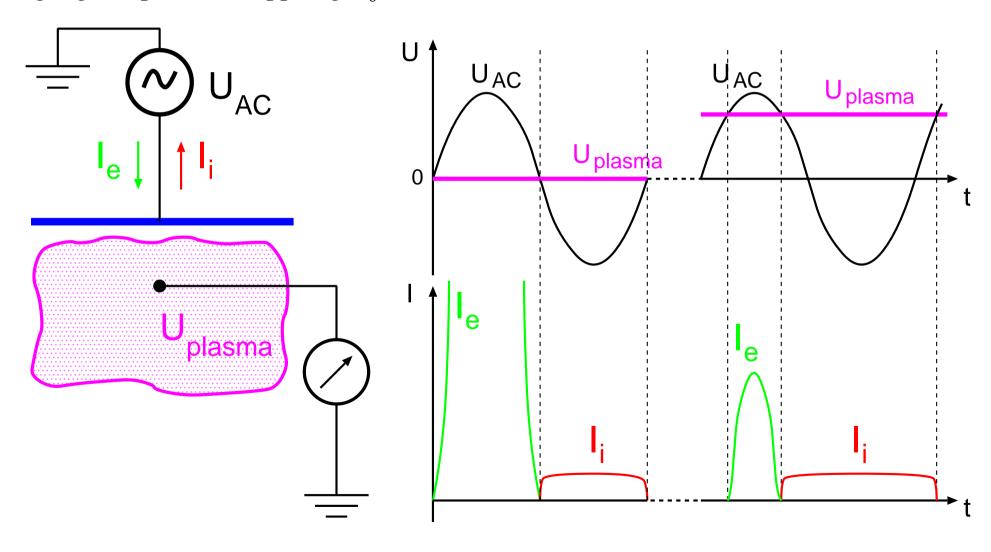
### Zahlen-Beispiele:

$k_BT$	~ 10	~ 100	eV
σ	$10^{-15}$	$10^{-14}$	$cm^2$
$p_0$	0.1	1	Pa
$v_c$	40	1200	MHz

### **HF-Randschicht**

Aufgrund der unterschiedlichen Ionen- und Elektronen-Beweglichkeiten lädt sich das Plasma bei HF-Einkopplung positiv auf.

Bedingung: (kapazitive Kopplung):  $\int \sum I \, dt = 0$ 



### Elektrische Leitfähigkeit im neutralen <u>Plasma</u>

$$n_e \approx n_i, \, \sigma_e \gg \sigma_i$$

→ Elektronen tragen Strom

$$j_p = (\sigma_e + i\omega \varepsilon_0)E_p = \left(\frac{\omega_{p,e}^2 \varepsilon_0}{v_c} + i\omega \varepsilon_0\right)E_p$$

$$\omega \ll \omega_{p,e}^2/\nu_c \quad \Rightarrow \quad j_p = \sigma_e E_p$$

#### Beispiel:

Benutze technische Hochfrequenz f = 13.56 MHz ( $\omega = 2\pi f = 85 \text{ M rad/s}$ )

Sei 
$$n_e = 10^{15} \text{ m}^{-3} \quad \Rightarrow \quad v_c \sim 1 \text{ GHz}$$

$$\Rightarrow \omega_{p,e}^2/v_c = 3 \text{ G rad/s} \gg 85.2 \text{ M rad/s})$$

Im neutralen Plasma bestimmt die Elektronen-Beweglichkeit den elektrischen Widerstand, und der ist i.w. reell.

# Elektrische Leitfähigkeit in der Plasma-Randschicht

In der Randschicht:  $n_e \rightarrow 0$ 

⇒ Nur Ionen können (reelle) Leitfähigkeit herstellen.

Für  $\omega \gg \omega_{p,i}$  sind Ionen träge

(d.h. tragen nur Gleichstrom)

Beispiel: Ar (kalt), A = 40,  $n_e = 10^{15} \text{ m}^{-3}$  $\Rightarrow \omega_{p,i} \sim 6.5 \text{ M rad/s}; \quad (Z=1)$ 

Wohingegen schon für f = 13.56 MHz:

$$\omega = 2 \pi f = 85.2 \,\mathrm{M}\,\mathrm{rad/s}$$

Ampère´sches Gesetz:

$$j_s = (\sigma_i + i\omega \varepsilon_0)E_s = \left(\frac{\omega_{p,i}^2 \varepsilon_0}{v_{c,i}} + i\omega \varepsilon_0\right)E_s$$

NF-Fall:  $\omega \ll \omega_{p,i}^2/\nu_{c,i} \Rightarrow j_s = \sigma_i E_s$ 

HF-Fall:  $\omega \gg \omega_{p,i}^2/\nu_{c,i}$ 

$$j_s = i\omega \varepsilon_0 E_s = i\omega \frac{\varepsilon_0}{d_s} V_s = i\omega \frac{C_s}{A_s} V_s$$

( $C_s$ : RS-Kapazität,  $d_s$ : RS-Dicke,  $A_s$ : Fläche)

$n_i$	10 <sup>15</sup>	$3 \cdot 10^{17}$	$m^{-3}$
$\omega_{p,i}$	6.5	112	M rad/s
$v_{c,i}$	50	2	MHz
$\omega_{p,i}^2/\nu_{c,i}$	0.85	1300	M rad/s
$\omega = 85.2 \text{ M rad/s}$	HF-Fall	NF-Fall	

# Spannungsabfall über der Randschicht

Widerstandsheizung im Plasma:

$$P_p = R_p \cdot I_p^2 = \frac{I_p^2 d_p}{\sigma_e A_p}$$

Stromkontinuität:  $I_s = I_p = I$ 

$$A_s j_s = A_p j_p = \left(\frac{P_p \sigma_e A_p}{d_p}\right)^{1/2}$$

DC, NF:  $\sigma_i E_s A_s = \sigma_e E_p A_p$ 

$$\Rightarrow \frac{E_s}{E_p} = \frac{\sigma_e A_p}{\sigma_i A_s} \sim O\left(\frac{A_p}{A_s} \sqrt{\frac{m_i}{m_e}}\right)$$

HF:  $\varepsilon_0 i\omega E_s A_s = \sigma_e E_p A_p$ 

$$\Rightarrow \frac{|E_s|}{E_p} = \frac{\sigma_e}{\varepsilon_0 \omega} \frac{A_p}{A_s} = \frac{\omega_{p,e}^2}{v_c \omega} \frac{A_p}{A_s}$$

Spannungsabfall:

$$U_s = E_s \cdot d_s \propto \frac{I}{A_s} \propto \frac{\sqrt{P_p}}{A_s}$$

N.B. Vereinfachtes Modell!

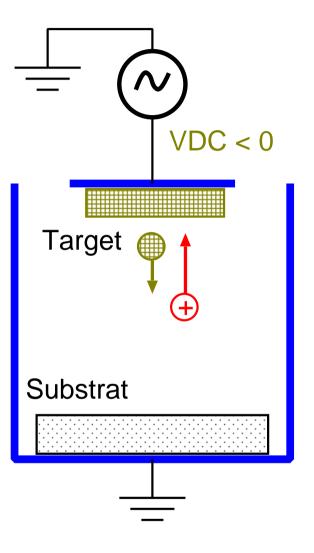
Experimentell:  $U_s \propto A_s^{-n} \quad (n \ge 1)$ 

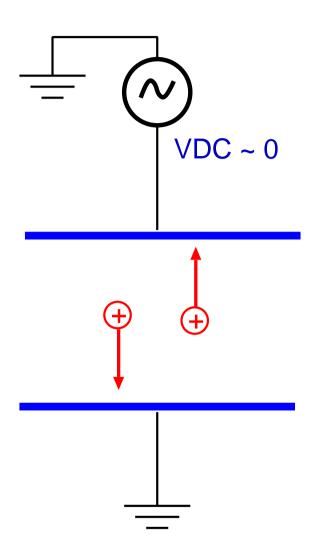
Generell: Je kleiner die Elektrodenfläche, desto größer die abfallende

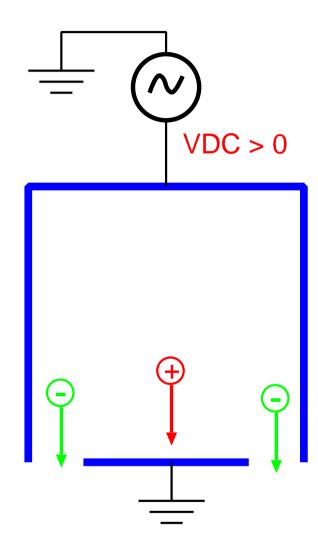
Randschichtspannung!

⇒ "Self-bias" bei asymmetrischen Elektroden.

# **Anwendungen CCP**







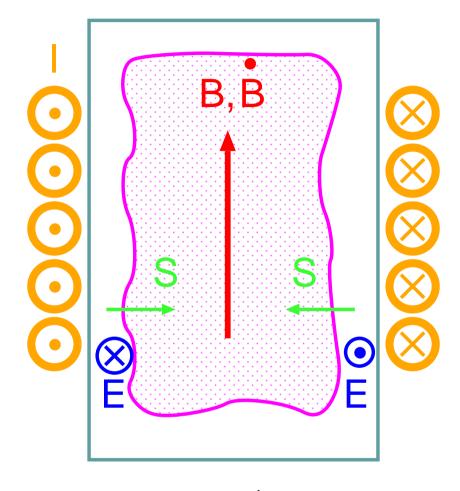
Zerstäuben und Beschichten

(Reaktives) Ätzen

Hohlkathoden-Elektronenquelle

## **Induktiv gekoppeltes HF-Plasma**





Faraday:  $\nabla \times \vec{E} = -\dot{\vec{B}}$ 

## Eindringtiefe des Wechselfeldes

Wellengleichung im Plasma:

$$-
abla imes\left(
abla imesec{E}
ight)=\mu_0\dot{ec{j}}+\mu_0arepsilon_0\ddot{ec{E}}$$

wobei  $\vec{j} = \sigma \vec{E}$  (s.o.)

Ansatz (Ausbreitung in z-Richtung):

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp[i(k \cdot z - \omega t)]$$

Def.  $\vec{k} = (0, 0, k), \quad k = \alpha + i/\delta,$ 

α: Wellenzahl,

δ: Eindringtiefe (*skin depth*)

$$k^{2} = i\omega\mu_{0}\sigma - \omega^{2}\mu_{0}\varepsilon_{0} = i\frac{\omega\sigma}{c^{2}\varepsilon_{0}} - \frac{\omega^{2}}{c^{2}}$$

Re(k):

$$\alpha = \sqrt{\frac{\sigma\mu_0\omega}{2}} \left[ \frac{\omega\epsilon_0}{\sigma} + \sqrt{1 + \left(\frac{\omega\epsilon_0}{\sigma}\right)^2} \right]^{1/2}$$

Im(k):

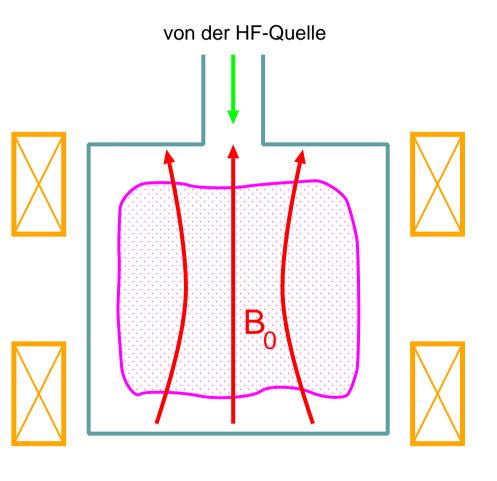
$$\frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\sigma\mu_0\omega}{2}} \left[ -\frac{\omega\epsilon_0}{\sigma} + \sqrt{1 + \left(\frac{\omega\epsilon_0}{\sigma}\right)^2} \right]^{1/2}$$

 $\omega \, \epsilon_0 \ll \sigma$ :

$$rac{1}{\delta}pprox\sqrt{rac{arsigma\mu_0\omega}{2}}$$

## Elektron-Zyklotron-Resonanz-Plasma

Im magnetisierten Plasma wird HF an Resonanzen absorbiert.



Heizung erfolgt nahe der

Elektronen-Zyklotron-Resonanz:

$$\omega = \omega_{c,e} = \frac{eB}{m_e}$$

Technisch gebräuchlich:

 $B_0 = 87.5 \text{ mT (Helmholtz-Spulenpaar)}$ 

$$\Rightarrow f_{c,e} = \omega_{c,e}/2\pi = 2.45 \text{ GHz (Magnetron)}$$

Vorteile:

—  $\omega_{c,e} \gg \omega_{p,e}, \nu_c$  möglich,

Welle dringt in das Plasmainnere ein und wird doch gut absorbiert

— Ort der Heizung wird durch Verlauf von  $\vec{B}$  eingestellt: Homogene Heizung möglich

# **Zyklotron-Resonanz**

Bewegungsgleichung Elektron

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -e\left(\vec{E} + \vec{v} \times B\right) - m\mathbf{v}_{c}\left(\vec{v} - \vec{u}\right)$$

Elektrisches Wechselfeld  $\vec{E} = (E_o, 0, 0) \sin \omega t$ ,

Statisches Magnetfeld  $\vec{B}_0 = (0, 0, B_0)$ .

$$m\ddot{x} + mv_c\dot{x} + eB_0\dot{y} = -eE_0\sin\omega t$$
  

$$m\ddot{y} + mv_c\dot{y} - eB_0\dot{x} = 0$$
  

$$m\dot{v}_z + mv_cv_z = 0$$

Lösung in z-Richtung:

$$v_z(t) = v_{0,z} \exp(-v_c t)$$

Def. "Zyklotronfrequenz":

$$\omega_c \equiv \frac{eB}{m}$$

Ansatz in *x* und *y*-Richtung:

$$x = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$$
$$y = C_3 \sin \omega t + C_4 \cos \omega t$$

Einsetzen ergibt die Konstanten:

$$C_{1} = -\frac{eE_{0}}{2m\omega} \left[ \frac{(\omega + v_{c})}{(\omega^{2} + \omega_{c}^{2}) + v_{c}^{2}} + \frac{(\omega - v_{c})}{(\omega^{2} - \omega_{c}^{2}) + v_{c}^{2}} \right]$$

$$C_{2} = -\frac{v_{c}eE_{0}}{2m\omega} \left[ \frac{1}{(\omega^{2} + \omega_{c}^{2}) + v_{c}^{2}} + \frac{1}{(\omega^{2} - \omega_{c}^{2}) + v_{c}^{2}} \right]$$

$$C_{3} = \frac{\omega_{c}(C_{1}v_{c} + C_{2}\omega)}{(\omega^{2} + v_{c}^{2})}$$

$$C_4 = -\frac{\omega_c(C_1\omega - C_2\nu_c)}{(\omega^2 + \nu_c^2)}$$

Nenner  $\omega^2 - \omega_c^2 \to 0$  für  $\omega = \omega_c!$  $\Rightarrow Resonanz$ , gedämpft durch Stöße.

# **Absorbierte Leistung**

Leistung auf ein Elektron (x-Richtung):

$$P_{e} = \frac{dW_{e}}{dt} = \frac{dW_{e}}{dx} \frac{dx}{dt} =$$

$$= eE_{0}\omega \left[ C_{1} \sin \omega t \cos \omega t + C_{2} \sin^{2} \omega t \right]$$

zeitgemittelte Leistung auf ein Elektron:

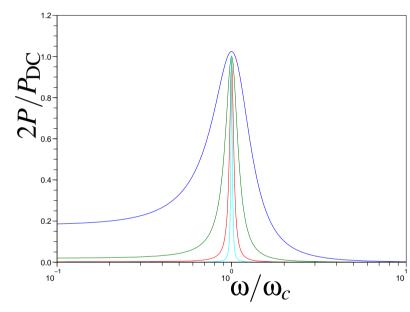
$$< P_e > = \frac{e^2 C_2 E_0^2}{2} = \frac{v_c e^2 E_0^2}{4m} \times \left[ \frac{1}{(\omega^2 + \omega_c^2) + v_c^2} + \frac{1}{(\omega^2 - \omega_c^2) + v_c^2} \right]$$

Mit  $W_E = \varepsilon_0 E_0^2 / 4$ , Leistungsdichte :

$$< P > = < W_E > \omega_{p,e}^2 \nu_c \left[ \frac{1}{(\omega^2 + \omega_c^2) + \nu_c^2} + \frac{1}{(\omega^2 - \omega_c^2) + \nu_c^2} \right]$$

Absorbierte Leistung:

$$(v_c^2 = 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 \times \omega_c^2)$$



Max. Leistung bei  $\omega = \omega_c$ :

$$< P>_{\max} \approx \frac{< W_E > \omega_{p,e}^2}{v_c} = \frac{1}{2} P_{DC}$$

## Zusammenfassung

- Niedertemperatur-Entladungen (DC wie HF) werden durch Stöße der Ladungsträger geheizt.
- Vorwiegend stoßen Elektronen mit Neutralen (Anregung, Ionisation), bei niedrigem Druck und sehr niedriger Elektronentemperatur tragen auch Coulomb-Stöße der Ladungsträger untereinander bei.
- Energieübertragungsfrequenz  $v_*$ : Rate mit der die elektrische Feldenergie in kinetische Energie umgewandelt wird.
- B = 0: Die Hochfrequenz kann kapazitiv (CCP) oder induktiv (ICP) eingekoppelt werden.  $v_*$  ist maximal bei  $\omega = v_c$ . Frequenzen unterhalb der Plasmafrequenz (Normalfall) dringen nur bis zur Skin-Tiefe in das Plasma ein (Heizung nur am Rand).
- Durch HF-Ströme baut sich eine Plasmarandschicht auf. Der Spannungsabfall steigt mit der Heizleistung und sinkt mit steigender Elektrodenoberfläche. Dies wird technisch genutzt, um die Bereiche mit Ionenbeschleunigung auf die gewünschten Flächen zu richten.
- $B \neq 0$ : Die Hochfrequenz wird an der Zyklotronresonanz  $\omega_c = eB/m_e$  absorbiert (ECR).  $\nu_*$  ist um  $\omega = \omega_c \pm \nu_c$  maximal. Die Heizleistungsdeposition kann ( $\omega_c > \omega_{p,e}$ ) durch die Feldverteilung eingestellt werden, z.B. zentral im Plasma.